

<第36回フォトポリマー講習会>

日時:2026年8月27日(木)・28日(金) 27日/9時30分～16時35分 28日/9時30分～15時25分

会場:オンライン開催(Zoom)

協賛:(社)日本化学会

[参加費]

会員:18,000円(4名以上参加の場合は一律65,000円/会員企業)

日本化学会会員:18,000円

非会員:28,000円、学生 8,000円

[参加申込]

当会ホームページ(<http://www.tapj.jp>)のメールフォームからお申し込み下さい。

受付後、事務局より参加方法についてご連絡いたします。

※テキストはメールフォームによる申し込み者にものみPDF配信いたします。

[締め切り]

2026年8月13日(木)

プログラム

[基礎編](8月27日(木)第1日目)

09:30～09:35	会長挨拶	大阪公立大学	堀邊 英夫
09:35～10:40	「光化学の基礎と分子デザイン」	成蹊大学	稲垣 昭子 氏
10:50～11:55	「ポリマーの光化学と特性」	大阪公立大学	岡村 晴之 氏
13:00～14:05	「リソグラフィの基礎とフォトレジストの材料設計」	Eリソサーチ	遠藤 政孝 氏
14:15～15:20	「フォトポリマーの特性評価」	リソテックジャパン(株)	関口 淳 氏
15:30～16:35	「レジストの分析」	(株)東リサーチセンター	小北 哲也 氏

[応用編](8月28日(金)第2日目)

09:30～10:35	「光酸発生剤の基礎と先端材料への応用」	富士フイルム(株)	土村 智孝 氏
10:45～11:50	「感光性ポリイミドの歴史」	東レ(株)	富川 真佐夫 氏
13:00～14:05	「MEMSプロセスとデバイス開発」	東北大学	戸津 健太郎 氏
14:15～15:20	「微細加工用レジスト」	兵庫県立大学	渡邊 健夫 氏
15:20～15:25	運営委員長閉会挨拶	東京理科大学	青木 健一